17p-A10-16

## SrTiO<sub>3</sub>(110)基板上における[CaBO<sub>3</sub>/BiFe<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>O<sub>3</sub>]人工超格子 (B=Fe, Mn)の作製及び電気的・磁気的性質

Fabrication and Electric / Magnetic Properties of [CaBO<sub>3</sub>/ BiFe<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>O<sub>3</sub>] (B=Fe, Mn) Superlattices Grown on the SrTiO<sub>3</sub>(110) Substrates

日大理工<sup>1</sup>, IMS Univ. of Twente<sup>2</sup>, 日大文理<sup>3</sup> 渡部 雄太<sup>1</sup>, 及川貴大<sup>1</sup>, 稲葉隆哲<sup>1</sup>, 大島佳祐<sup>1</sup>, Mark Huijben<sup>2</sup>, Guus Rijnders<sup>2</sup>, 橋本 拓也<sup>3</sup>, 高瀬浩一<sup>1</sup>, 山本 寛<sup>1</sup>, °岩田 展幸<sup>1</sup>

CST Nihon Univ.<sup>1</sup>, IMS Univ. of Twente<sup>2</sup>, CHS Nihon Univ.<sup>3</sup>, Yuta Watabe<sup>1</sup>, Takahiro Oikawa<sup>1</sup>,

Takaaki Inaba<sup>1</sup>, Keisuke Oshima<sup>1</sup>, Mark Huijben<sup>2</sup>, Guus Rijnders<sup>2</sup>, Takuya Hashimoto<sup>3</sup>,

Kouichi Takase<sup>1</sup>, Hiroshi Yamamoto<sup>1</sup>, <sup>o</sup>Nobuyuki Iwata<sup>1</sup>

E-mail: iwata.nobuyuki@nihon-u.ac.jp

本研究の目的は、酸化物人工超格子を作製し、室温で強誘電性強磁性マルチフェロイック特性を 示し、さらに電界で磁気特性を制御できる特性(巨大電気磁気効果)を発現させることである。PLD 法により、材料"A"、"B"を交互に積層させた酸化物人工超格子を SrTiO<sub>3</sub>(STO)(110)基板上に作製 し、結晶構造および電気的・磁気的性質を評価した。

材料"A"は BiFeO<sub>3</sub>(BFO), BiFe<sub>0.9</sub>Mn<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub> (BFMO)、材料"B"は CaFeO<sub>3</sub>(CFO)、CaMnO<sub>3</sub>(CMO)とした。 超格子は各層 7 ユニットを 14 回繰り返して堆積し [7units 材料"A" / 7units 材料"B"]<sub>14</sub>人工超格子を 作製した。RHEED の反射光強度をモニタリングしながら原子層レベルの成長制御を行った。PLD 成膜では、同じセッティングであっても成膜ごとに成長速度に数%の誤差がある。そのため、超 格子作製直前に STO を 7 ユニット成長させて成膜速度を確認し、その他各薄膜に対して所望のユ ニット数が成長するように照射パルス数を算出して成膜を行った<sup>[1,4]</sup>。

STO を7ユニット成膜し成長速度を確認した後、[CFO<sub>7</sub>/BFO<sub>7</sub>]<sub>14</sub>人工超格子を成膜した。Fig.1 に (a)STO(110)基板表面像及び(b)CFO/BFO 人工超格子成膜後の薄膜表面像を示す。成膜前の表面像

では STO 基板特有のステップテラス構造が確認 できた。成膜後の薄膜表面像はステップテラス構 造を確認できるが、テラス上に高低差が 2nm の 針状のグレインが STO[001]方向に成長している ことが確認できた。BFO 単相膜の一軸異方性を持 った成長を反映していた。

STO(110)周辺の XRD 2 $\theta$ - $\theta$ パターンを Fig.2 に 示す。基板ピーク周辺に Laue 振動が明瞭に現れ た。Laue 振動は薄膜全体が均一に成長している ことを示している。Laue 振動の間隔から算出し た[CFO<sub>7</sub>/BFO<sub>7</sub>]<sub>14</sub> 格子の膜厚は 47.9 nm であるこ とが分かった。また、ロッキングカーブの半値幅 は 0.1012° と結晶性が高いことがわかった。

その他人工超格子作製・結晶構造、電気的磁気的特性については当日報告する。

[1]N Iwata, et al., Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 05FB20.

[2]Y. Watabe, et al., Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 05FB12.

[3]N. Iwata, *et al.*, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. **1454** (2012) 161.

[4]N. Iwata, et al., Trans. Mater. Res. Soc. Jpn. 37 (2012) 381



0.0 [nm] 16.2 0.0 [nm] 9.3 Fig.1 (a)STO(110)基板表面像 (b)CFO/BFO 人工超格子成膜後の薄膜表面像(5µm×5µm)

